

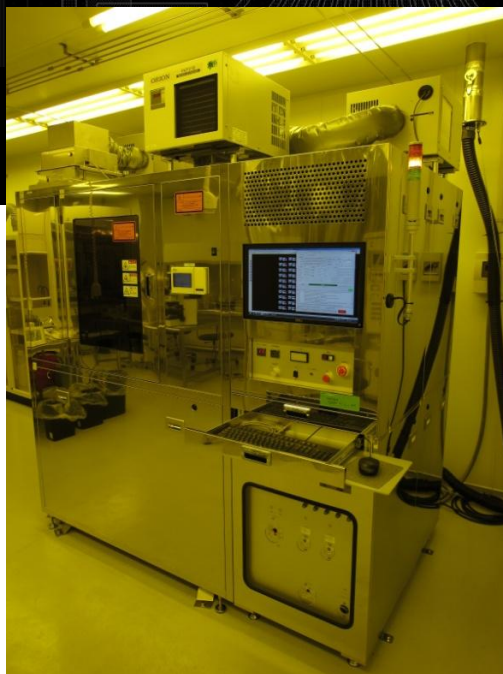
# 描画

## マスクレス露光装置

大日本科研社製 MX-1204型 (IP-1009-2)

### 仕様

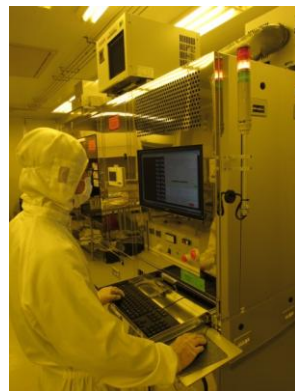
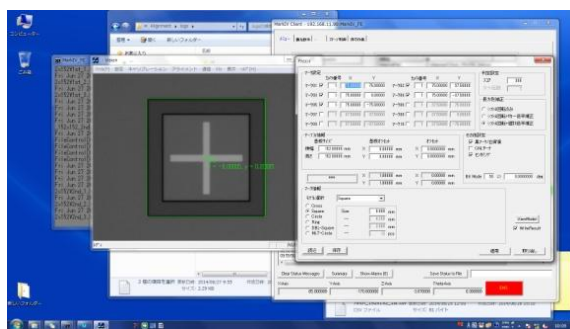
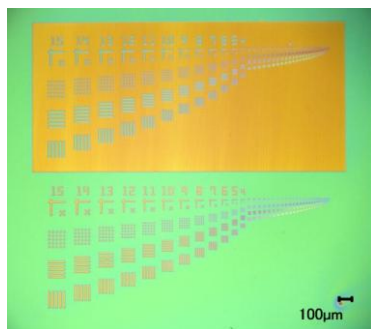
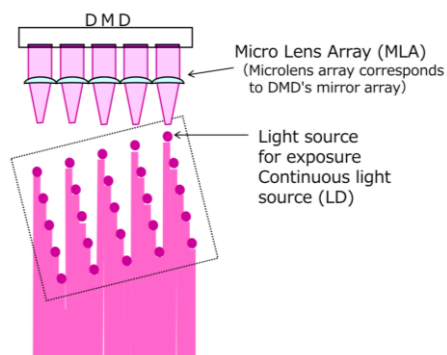
光源	LD (波長 $375\pm 5\text{nm}$ )
描画方法	直接描画
描画対象	6インチまで対応可能
描画精度	最小線幅 $1\mu\text{m}$ 程度
アライメント精度	$0.15\mu\text{m}$ 以下
描画所要時間	6インチウエハに描画 約30分
対応ファイル形式	GDS II, CIF, DXF, GERBER ファイル



### 基板上への直接描画

レジストを塗布したSiやガラス基板、デバイス上にDMD方式で直接マスクパターン(最小線幅 $1\mu\text{m}$ )を高速描画します。

マスクが不要な少数デバイスの試作にも有効であり、基板上のパターンへの重ね合わせ描画、グレースケール露光も行えます。



「文部科学省ナノテクノロジープラットフォーム事業」

微細加工プラットフォーム ・ 香川大学



お問い合わせ先

香川大学 産学連携・知的財産センター  
ナノテクノロジー支援室

TEL/FAX : 087-887-1873

E-mail : nanoplatform-c@kagawa-u.ac.jp